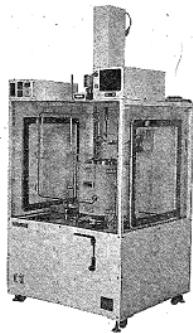


エピクエスト

製造装置・部材関連・FA



(株)エピクエスト(京都都市
南区)は、SiCやGaN
向けにKOHエッチング装置(写真)
の販売が好調だ。
2013年の発売以来、国
内外の企業や大学、研究機
関へ20台の納入実績を上
げており、特に近年はパワー

デバイス向けに引き合いが大幅に増加している。23年も好調な出荷を維持する見通しで、欧州市場向けにC Eマーク取得モデルを開発・投入する。

つ。S-iC関連では、関西学院大学の金子忠昭教授と超高温プロセス炉などの装置技術で協力している。

処理を自動で行える。最大8インチに対応可能。この工程を国内で装置化しているのは同社が唯一だ。

きた」(禪野氏)。同社では現在、欧州への輸出に不可欠なCEマーク。

る」(津野氏) ことも視野に入れしており、さらなる需
要増に備える考えだ。

SiC/GaN欠陥解析 SHエッヂチャート好調

S-iC／GaNウエハ－の欠陥解析には非破壊検査装置を用いるケースもあるが、「エッティング方式は一定程度の浸漬で済むため、短時間」で見えるのが利点（専務取締役の禅野由明氏）。さらに、近年はS-iCの量産拡大や8インチの大口径化で処理量 자체も増えており、「量産用に既存顧客から複数台の発注が

を取得するため、これに対応した8インチ用新モデルを開発中。「KOHの溶液や蒸気との接触・暴露を避けるため、処理を密閉空間で行えるようロードロットク室と処理室の2室構成とする予定」。5月中にも組み上げを完了し、23年内の出荷を目指す。

今後については「顧客の要望によるが、KOHを満たす塙堀(るっぽ)の洗浄

つ。SiC関連では、関西学院大学の金子忠昭教授と超高温プロセス炉などの装置技術で協力している。KOHエッチング装置は、SiCやGaNウエハを約500°Cに昇温したKOH(水酸化カリウム)溶液に浸して表面を均一にエッチングし、ウエハーの結晶欠陥(エッチャビットなど)を露出させるために使之を手がけ、特に研究開発でCVD装置などを用いて、専門性を維持する見合モデルを開発している。23年春市場向けにCVDやMBE、CVD装置など手がけ、特に研究開発で小規模量産用に強みを持つ

このエッチング処理工程は、SiC/GaNウエハメーカーの品質検査やグレードの分類に不可欠であるほか、デバイスマーケターが不良解析に用いるケースも増えている。また、ファインセラミックスセンターは、本プロセスを用いて、SiCウエハーの欠陥解析評価の受託サービスを展開

「きた」（禅野氏）。
同社では現在 欧州への
輸出に不可欠なCEマーク
要増に備える考えだ。
る」（禅野氏）ことも視野
に入れており、さらなる需